INDEX - Années 1975-1976

A. BASES FONDAMENTALES

A.1. Théorie cinétique, etc.

BRINI J., 182, 63-68, Phénomènes de transport dans les milieux désordonnés. Introduction à la théorie de la percolation.

HAEFFER R.A., KLEBER P., 181, 19-21, Measurements of molecular flow patterns in vacuum chambers with cryo-surfaces.

A.2. Milieux ionisés

KAY E., COBURN J.W., KRUPPA G., 183, 89-95, Mass spectrometric studies of both polymerizing and etching fluorcarbons glow discharges.

A.3. Physique et chimie des surfaces

A.3.1. Théorie

ABERDAM D., 176, 76-85, La diffraction des électrons lents : espoirs et limites.

ALLAN G. et LANNOO M., 176, 48-49, Travaux de sortie des métaux de transition.

DJAFARI-ROUHANI B., DOBRYNSKI L., 177-178, 108-112, Magnons d'interfaces. Surstructure magnétique.

KOROLITSKI J.P., LEVY J.C., 177-178, 105-107, Problème d'interface : propagation d'ondes de spin entre deux films.

VU THIEN BINH, COUTURIER J.V., CHAUDIER M., UZAN R. et DRESCHLER M., 176, 44-47, Evolution par diffusion de surface, d'un sillon de joint de grain sur un fil de petit diamètre.

A.3.2. Etudes expérimentales

AGIUS B., 177-178, 121-129, Microanalyse de la région superficielle des solides par l'observation directe de réactions nucléaires et de la diffusion élastique.

AMSEL G., DAVID D., 177-178, 130-132, Mesure de profils de concentration en oxygène 18 au voisinage d'une surface par la réaction résonnante 180(Pa)15N.

ARSALANE M., 184, 148-153, Les centres coulombiens du sulfure de zinc pulvérisé au cours de la stabilisation par recuit.

BASSETT D.W., CHUNG C.K. and TICE D., 176, 39-43, Field ion microscope studies of atomic displacement processes on metal surfaces.

BERNHEIM M., 176, 56-61, Microanalyse par émission ionique.

BONNELLE J.P., GRIMBLOT J., D'HUYSSER A. et BEAUFILS J.P., 176, 86-87, Application de l'ESCA à l'étude d'oxydes à base de cobalt.

CLERC C., VIKTOROVITCH P. et KAMARINOS G., 176, 50-52, Etude des propriétés électriques de l'interface liquide-semiconducteur.

COMSA Gerda-Hanne, HENSEL F. and RINGELMANN F., 177-178, 113-116, Size characterization of small metal particles.

DELRUE J.P., ROBERT T., 177-178, 143-146, Etude de l'activité catalytique du platine. Relation avec l'examen d'espèces oxygénées de surface par spectroscopie de photoélectrons (E.S.C.A.).

FIERMANS L. and VENNIK J., 177-178, 138-142, Photoemission of solid surfaces.

GUICHAR G.M., SEBENNE C., GARRY G. et BALKANSKI M., 176, 88-90, Propriétés électroniques de surface du silicium (111) clivé sous ultravide par mesure du spectre de photoémission ; effets des recuits.

HUNSPERGER R.G., 185, 175-181, Characterization and modification of GaAs semi-insulating substrates.

JOUBERT P., BERTHOU L., GUIVARC'H A., 180, 210-213, Application de la rétrodiffusion d'ions He^+ canalisés à l'étude des surfaces après attaque ionique.

JUPILLE J., 181, 30-32, Adsorption de l'oxygène sur la solution solide niobium-oxygène aux hautes températures.

LECANTE J., 176, 62-69, Spectroscopie de pertes d'énergie d'électrons appliquée à l'étude des surfaces solides.

LOPEZ-RIOS T. et TADJEDDINE A., 176, 53-55, Etude de l'interface métal-électrolyte par ellipsométrie avec plasmons de surface.

MARESCHAL J., 184, 154-156, Oxydes réfractaires utilisables comme substrats pour l'hétéroépitaxie du silicium.

POULIQUEN J., DEFEBVRE A., 177-178, 117-120, Production d'ondes de Rayleigh sur matériaux isotropes par transfert acoustiques. Application à l'étude des phénomènes superficiels de déformation, fatigue ou corrosion sur acier.

RONDOT B., PONS F., LE HERICY J., DA CUNHA BELO M. et LANGERON J.P., 176, 70-75, Etude par spectroscopie Auger des films de passivation formés à la surface des aciers inoxydables.

SEGUIN M., SERZEC B., FOURE J.L., LAGORSSE J.L., 179, 165-172, Dispositifs à ondes acoustiques de surface. Etude des ondes élastiques par interaction acousto-optique.

B. APPLICATIONS

B.1. Analyse des surfaces

BAHEZRE Cl., 179, 186-190, Analyse des couches minces à la microsonde électronique. Application aux dépôts « semi-minces » (0,5 à 1μm) de type $Cd_xHg_{1-x}Te$.

GALLOT J., SARRAU J., BOSTEL A., 179, 173-181, Fabrication et mise au point d'une sonde à atomes associée à un microscope ionique à champ.

SERVAIS J.P., GRAAS H., LEROY V., HABRAKEN L., 181, 27-29, Analyse quantitative de la surface de l'acier par microanalyse ionique.

B.2. Couches minces

AUBERT A., SPITZ L., 175, 1-7, Composition et structure des couches minces de nitrure et carboniture de niobium élaborées par pulvérisation cathodique réactive.

BUHLING D., MICHALOWSKY L., 185, 185-188, Influence of the manufacturing parameters on film structure and properties of reactively sputtered vanadium dioxide films.

CARADEC J.Y., PHILIPPART J.L., PIQUARD G., WEBER B., BARGUES M. et METAY G., 182, 69-73, Réactions sous basse pression du chlore et des chlorures de tantale gazeux sur des surfaces de tantale. Application à la vapo-déposition.

DURAND S., BUGNET P., DEFORGES J., 175, 8-10, Pulvérisation cathodique réactive du sulfure de zinc activé au cuivre et au chlore.

FOLENS G., 184, 142-147, Production de jonctions superconductrices par pulvérisation haute fréquence et des techniques photolytographiques (en anglais).

FRANCOMBE M.H., 183, 96-100, Growth of epitaxial films by sputtering.

HANAK J.J., 175, 11-18, Copulvérisation : ses possibilités et ses limitations.

HENRY L., LAMY P., GUIVARC'H A., PELOUS G., 183, 101-106. Protection de l'arséniure de gallium porté à haute température, par dépôt pulvérisé de Si_3N_4 ou AlN.

HUBIN M., NONIS P., GOUAULT J., 181, 15-18, Comportement de tenue mécanique et d'isolement électrique de couches minces d'alumine évaporées sur substrat acier dans des conditions thermiques et mécaniques sévères.

LEPAGE F., DAVID D., BARDOLLE J., BOULBEN J.M., BERANGER G., 181, 22-26, Comparaison de diverses méthodes de mesure de films d'oxyde formés sur le molybdène et le titane.

TREGOUET Y., BERNEDE J.C., GOUREAUX G., 180, 217-219, Commutation dans des couches très minces de composés M.Te (M = Au, Ag, ou Al).

WEISSMANTEL C., 183, 107-116, Ion beam utilization for etching and film deposition.

B.3. Production des basses pressions et cryopompage

BECKER W. et NESSELDREHER W., 182, 59-62, Nouveaux disques à grand rendement pour pompes turbo-moléculaires.

FLESH G., HENRIOT C., ROMMEL G., 179, 182-184, Performances d'une pompe cryogénique à 20 K.

B.4. Mesure et régulation des basses pressions

DE CHERNATONY L., AUSTIN M., YARWOOD J., SOUTHON M.J. and BOYES E.D., 177-178, 133-137, Improvements in the use of a field emission microscope to measure hydrogen pressures in the ultra high vacuum region.

PROTIN L., 185, 167-174, Régulation de la pression à l'intérieur d'un dispositif de pulvérisation radio-fréquence.

B.5. Milieux ionisés

NESSELDREHER W., 182, 74-81, Influence de différents paramètres sur les spectres de masse des pompes turbo-moléculaires.

B.6. Physique appliquée du solide

B.7. Electronique

GARCIA M., GAILLARD J.P., ROUSSIN J.C., 185, 182-184, Implantation de fortes doses d'antimoine pour l'application à l'épitaxie fine de silicium sur couches enterrées.

HOLLAN L., 184, 131-137, Evolution des techniques d'élaboration de GaAs épitaxial pour les dispositifs hyperfréquences.

MISIANO C., 184, 138-141, Décapage par pulvérisation cathodique de matériaux massifs sous atmosphère contrôlée (en anglais).

ZOZIME A., DRAPPIER H., SELLA C., CHAUVEAU M., COHEN-SOLAL G., 175, 19-22, Dopage in-situ de couches minces de $Cd_xHg_{1-x}Te$ obtenues par pulvérisation cathodique en atmosphère de mercure. Application à la réalisation de détecteurs d'infrarouges.

B.10. Métallurgie

BERVE J., STOLTE G., 180, 214-216, The B-V-Building-block-system for vacuum metallurgy.

CASTRO R., 180, 201-209, Impuretés et propriétés des aciers.

WINCKLER O., 181, 1-14, Le développement de la métallurgie sous vide et ses perspectives.

Le Directeur de la Publication : M.E. BACQUET. Imprimé en France. Imp. Marcel Bon, Vesoul — Dépôt légal Imp. N° 153-III-77
Commission paritaire n° 32.348